**Сильницкая Ольга Андреевна. Исследование и разработка процессов формирования наноструктурированных барьерных слоев на основе фторуглеродных пленок: автореферат дис. ... кандидата Технических наук: 05.27.06 / Сильницкая Ольга Андреевна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»], 2018**